

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成17年4月14日(2005.4.14)

【公開番号】特開2002-118098(P2002-118098A)

【公開日】平成14年4月19日(2002.4.19)

【出願番号】特願2000-308749(P2000-308749)

【国際特許分類第7版】

H 01 L 21/3065

H 01 L 21/205

H 05 H 1/46

【F I】

H 01 L 21/302 B

H 01 L 21/205

H 05 H 1/46 L

【手続補正書】

【提出日】平成16年6月7日(2004.6.7)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板を載置するサセプタが配置される反応室と、前記反応室上に載置されたプラズマ発生容器とを有するプラズマ処理装置であって、前記反応室のうち前記プラズマ発生容器を載設する面には凹部を有し、前記凹部に弾性シール材を設けて前記プラズマ発生容器と前記反応室とを密閉するとき、前記反応室、前記プラズマ発生容器の少なくとも一方には前記凹部と前記プラズマ発生容器の内壁面との間に凸部を有することを特徴とするプラズマ処理装置。